图 93117194

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告組號: 484197

[44]中華民國 91年 (2002) 04月21日

發明

全9頁

[51] Int.Cl 07: H01L21/88

[54]名 稱: 半導整晶層上不良來源之即時辨識

[21]申請案號: 089114479 [22]申請日期:中華民國 89年 (2000) 07月 19日

[30]優先權: [31]09/358,512 [32]1999/07/21 [33]美國

[72]愛明人:

山森索米克 阿摩茲麥門 美國美國

[71]申請人:

應用材料股份有限公司

美國

[74]代理人: 萘坤財 先生

1

[57]申請專利範圍:

1.一種半導體晶團的檢測方法,該方法至少包含:

讓該晶圓接受由多個處理工具所實施的多個處理步驟,每一處理工具分別相關於一不同的工具辨識子; 貯存該等工具辨識子;

用一檢測工具來檢測該晶圓的瑕 疵;及

使用該檢測工具來產生一工具辨識 子的表單。

- 2.如申請專利範圍第1項所述之方法, 其進一步包含將該工具辨識子表單 顯示在該檢測工具上。
- 3.如申請專利範圍第1項所述之方法, 其進一步包含: 將該工具辨識子貯存在一製造執行

系統(MES)中:及

由該 MES 取得該工具辨識子以產生 該工具辨識子表單。

4.如申請專利範圍第3項所述之方法,

其中每一工具辨識子分別與一組不 同的處理參數相關連, 該方法進一 步包含:

將處理參數組貯存於 MES 中:

- 5. 在產生該工具辨識子表單之後,取 得與其中之一工具辨識子相關之處 理參數組;及 將與該工具辨識子相關之處理參數 組顯示於該檢測工具上。
- 10. 5.一種半導體晶圓的檢測方法,該方法 至少包含:

讓該晶圓接受由多個處理工具所實施的多個處理步驟,每一處理工具 分別相關於一不同的工具辨識子:

15. 貯存該等工具辨識子;

用一檢測工具來檢測該晶圖上可能 的的瑕疵位置:

判斷在該晶圓可能的瑕疵位置的數 目及可能的瑕疵位置的密度用以決

20. 定該晶圓的瑕疵位準;及

- 3675 -

(2)

3

當該瑕疵位準等於或大於一預設的 瑕疵位準時,用該檢測工具產生一 工具辨識子的表單,該預設的瑕疵 位準包含該晶圓上之可能瑕疵位置 的預設數目及/或密度。

- 6.如申請專利範圍第5項所述之方法, 其進一步包含將該工具辨識子表單 顯示在該檢測工具上。
- 7.如申請專利範圍第1項所述之方法, 其進一步包含: 在檢測該晶圓的瑕疵時,用該檢測 工具將瑕疵分類成預設的瑕疵種 類;及 將瑕疵種類與工具辨識子關連在一
- 8.如申請專利範圍第1項所述之方法, 其進一步包含: 將晶圓上之可能的瑕疵位置與參考

位置成像用以產生可能的瑕疵影像 及參考影像:

辨識那些瑕疵影像代表實際的瑕 疵;

將實際的瑕疵歸類至預設的瑕疵種 類:及

將這些瑕疵種類與工具辨識子關連 在一起·

9.如申請專利範圍第7項所述之方法, 其進一步包含:

决定在每一瑕疵種類中之瑕疵總 數;

決定每一瑕疵種類之分類警示位 準:

當在一特定的瑕疵種類中之瑕疵糖 數等於或大於相對應之分類警示位 準時,產生一警示訊號;及

顯示與該特定的瑕疵種類相關連的 工具辨識子•

10.如申請專利範圍第8項所述之方 法,其進一步包含:

决定在每一瑕疵種類中之瑕疵總 40.

數:

決定每一瑕疵種類之瑕疵種類警示 位準:

- 當在一特定的瑕疵種類中之瑕疵總 數等於或大於相對應之瑕疵種類響 示位準時,產生一警示訊號;及 顯示與該特定的瑕疵種類相關連的 工具辨識子。
- 11.一種用來檢測一半導體晶圓的檢測 10. 工具,該半導體晶圓已在一製造工 廠中接受過多項處理步驟,該製造 工廠包含多個處理工具,每一處理 工具分別相關於一不同的工具辨識 子,該製造工廠進一步包含一貯存 媒體以貯存該等工具辨識子,該檢 測工具包含:
 - 一成像器,用來檢驗該晶圓的瑕疵:及
- 一第一處理器,用來產生對應於該 20. 晶鳳曾造訪過之工具的工具辨識子 的表單。
 - 12.如申請專利範圍第11項所述之檢測 工具,其進一步包含一監視器,用 來顯示該工具辨識子的表單。
- 25. 13.如申請專利範園第11項所述之檢測 工具・其中該貯存媒體為一MES: 及 該第一處理器可從該 MES 取得該工

該新一處理器可從較MES 取得該工 具辨識子以產生工具辨識子的表 單。

- 14.如申請專利範圍第13項所述之檢測 工具,其中每一工具辨識子分別與 一組不同的處理參數相關連;
- 該 MES 貯存該等處理參數組;及 35. 該第一處理器可取得與該等工具辨 職子相關連的處理參數組。
 - 15.如申請專利範圍第11項所述之檢測 工具,其中該成像器是用來檢測晶 圓上可能的瑕疵位置;及
- 40. 該第一處理器可判斷在該晶圓可能

30.

5

的瑕疵位置的數目及可能的瑕疵位置的密度用以決定該晶圓的瑕疵位準,且當該瑕疵位準等於或大於一預設的瑕疵位準時,產生該工具辨識子的表單,該預設的瑕疵位準包含該晶圓上之可能瑕疵位置的預設數目及/或密度。

- 16.如申請專利範圍第15項所述之檢測 工具,其進一步包含一監視器,用 來顯示該工具辨識子的表單。
- 17.如申請專利範團第11項所述之檢測工具,其中該第一處理器可在該成像器檢驗晶圖的瑕疵時將瑕疵分類為預設的瑕疵種類,並將該瑕疵種類與工具辨識子關連在一起。
- 18.如申請專利範圍第11項所述之檢測工具,其中該製造工廠進一步包含一瑕疵分類器其具有一瑕疵位置及檢 像器用以產生可能的瑕疵位置及參 靠位置的影像:一比較器用來比較可能的瑕疵之影像與參考影像:及 一第二處理器用來辨識那些可能的 瑕疵影像代表實際的瑕疵並將實際 的瑕疵歸類為預設的瑕疵種類。
- 19.如申請專利範國第11項所述之檢測工具,其中該成像器用來產生可能的瑕疵位置及參靠位置的影像; 該檢測工具進一步包含一比較器用來比較可能的瑕疵之影像與參考影像;及

該第一處理器可辨識那些可能的瑕 疵影像代表實際的瑕疵並將實際的 瑕疵歸類為預設的瑕疵種類並將瑕 疵種類與工具辨識子關連在一起。

- 20.如申請專利範圍第17項所述之檢測 工具,其進一步包含:
 - 一計數器,用來計數在每一瑕疵種 類中之瑕疵總數:
 - 一警示產生器,用以當在一特定的瑕疵種類中之瑕疵總數等於或大於

相對應之瑕疵種類警示位準時,產 生一警示訊號;及

6

- 一監視器 · 用來顧示與該特定的瑕疵種類相關運的工具辨識子 ·
- 21.如申請專利範圍第18項所述之檢測 工具,其進一步包含:
 - 一計數器,用來計數在每一瑕疵種 類中之瑕疵總數;
- 一警示產生器,用以當在一特定的 10. 瑕疵種類中之瑕疵總數等於或大於 相對應之瑕疵種類警示位準時,產 生一警示訊號:及
 - 一監視器,用來顯示與該特定的瑕 統種類相關連的工具辨識子。
- 15. 22.如申請專利範圍第19項所述之檢測 工具,其進一步包含:
 - 一計數器,用來計數在每一瑕疵種 類中之瑕疵總數:
- 一替示產生器,用以當在一特定的 20. 瑕疵種類中之瑕疵總數等於或大於 相對應之瑕疵種類警示位準時,產 生一警示訊號;及
 - 一監視器·用來顯示與該特定的瑕 疵種類相關運的工具辨識子·
- 25. 23.如申請專利範圍第11所述之檢測工 具,其中該成像器包含一電荷耦合 裝置(CCD)或一光電倍增器。
 - 24.一種電腦可讀取的媒體,其載負了 用來檢測一半導體晶團的指令,該 晶圓已接受由多個處理工具所實施 的多個處理步驟,每一處理工具分 別相關於一不同的工具辨識子,當 該等指令被執行時可讓一或多個處 理器實施以下的步驟:
- 35. 取得該等工具辨識子; 控制一晶圓檢測工具以檢測該晶圓 的瑕疵;及
 - 產生該等工具辨識子的一表單。
- 25.如申請專利範圍第24項所述之電腦 40. 可讀取的媒體,其中當該等指令被

30.

7

執行時可促使一或多個處理器實施 將該工具辨識子的表單顯示在一監 視器上的步驟。

- 26.如申請專利範圍第24項所述之電腦 可贖取的媒體,其中當該等指令被 執行時可促使一或多個處理器實施 由該 MES 處取得該等工具辨識子的 步驟。
- 27.如申請專利範圍第26項所述之電腦可證取的媒體,其中每一工具辨識子分別對應於貯存在MES中的一組不同的處理參數,及當該等指令被執行時可促使一或多個處理器在產生該工具辨職子的表單之後實施由該MES處取得與該工具辨職子相關連的處理參數。
- 28.一種電腦可讀取的媒體,其戰負了 用來檢測一半導體晶團的指令,該 晶圓已接受由多個處理工具所實施 的多個處理步驟,每一處理工具分 別相關於一不同的工具辨識子,當 該等指令被執行時可讓一或多個處 理器實施以下的步驟:

取得改等工具辨識子;

控制一晶圓檢測工具以檢測該晶圓的瑕疵;

判斷在該晶圓可能的瑕疵位置的數 目及可能的瑕疵位置的密度以決定 該晶圓的瑕疵位準;及

當該瑕疵位準等於或大於一預設的 瑕疵位準時,產生一工具辨識子的 表單,該預設的瑕疵位準包含該晶 圖上之可能瑕疵位置的預數數目及/ 或來度。

- 29.如申請專利範團第24項所述之電腦 可讀取的媒體,其中當該等指令被 執行時可促使一或多個處理器實施 將該工具辨識子的表單顯示在一監 視器上的步驟。
- 30.如申請專利範圍第24項所述之電腦

可讀取的媒體,其中當該等指令被 執行時可促使一或多個處理器實施 以下的步驟:

在控制該晶圓檢測工具檢測該晶圓 瑕疵時,將瑕疵歸類至預設的瑕疵 分類中;及

> 將瑕疵分類與工具辨識子相關連在 一起。

31.如申請專利範圍第24項所述之電腦 10. 可讀取的媒體,其中當該等指令被 執行時可促使一或多個處理器實施 以下的步驟:

接收在晶圓上之可能的瑕疵位置及 参考位置的影像;

15. 比較可能的瑕疵影像及參考影像; 辨識那些瑕疵代表實際的瑕疵; 將瑕疵歸類至預設的瑕疵分類中; 及

將瑕疵分類與工具辨識子相關連在 20. 一起。

- 32.如申請專利範圍第30項所述之電腦 可讀取的媒體,其中當該等指令被 執行時可促使一或多個處理器實施 以下的步驟:
- 25. 决定在每一瑕疵種類中之瑕疵總 數:

當在一特定的瑕疵種類中之瑕疵總 數等於或大於該特定的瑕疵種類的 一預設的瑕疵種類響示位準時,產 生一警示訊號;及

30. 生一警示訊號:及 將與該特定的瑕疵種類相關連的工 與辨職子顯示於一監視器上。

- 33.如申請專利範圍第31項所述之電腦 可贖取的媒體,其中當該等指令被 5. 執行時可促使一或多個處理器實施 以下的步驟:
 - 決定在每一瑕疵種類中之瑕疵總 數:
- 當在一特定的瑕疵種類中之瑕疵總 40. 數等於或大於該特定的瑕疵種類的

(5)

9

一預設的瑕疵種類警示位準時,產 生一警示訊號:及

將與該特定的瑕疵種類相關連的工 具辨識子顯示於一監視器上。 圖式簡單說明:

第1圖顯示一將使用本發明加以 檢測之半導體晶圓•

第2圖為一流程圖,其顯示根據 本發明的一實施例之方法的一連串步 題。

第3圖顯示使用來實施本發明的

10

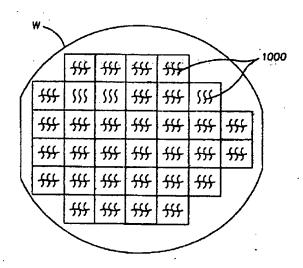
設備・

第4圖顯示由根據本發明的一實 施例之檢測工具所產生的瑕疵地圖·

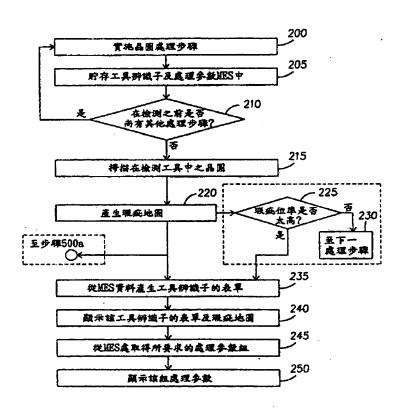
第5A圖為一流程圖,其顯示根據 5. 本發明的另一實施例之方法的一連串 步驟。

第58圖為一流程圖,其顯示根據 本發明的再另一實施例之方法的一連 串步驟•

10. 第6 圖為一方塊圖其顯示本發明 的一實施例。

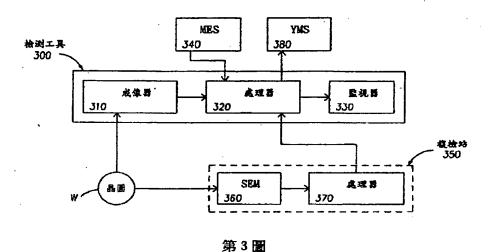


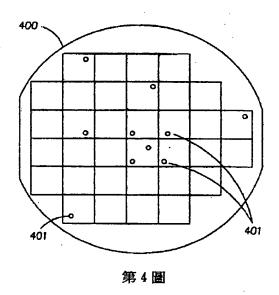
第1圖



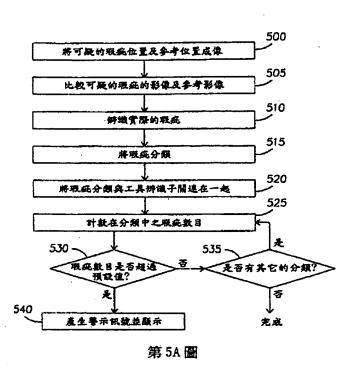
第2圖

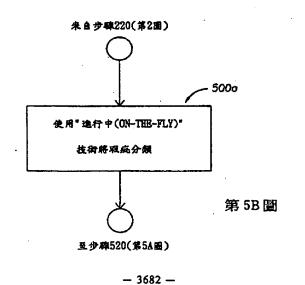
(7)



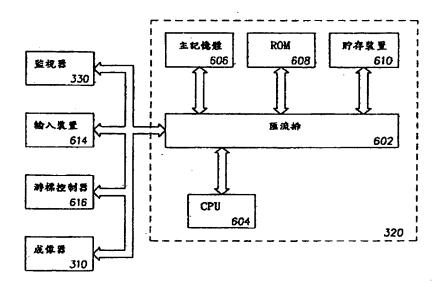


(8)





(9)



第6圖